

- (71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin
 (72) UDEH KENNETH O.; GLIBOWSKI PAWEŁ;
 JAROCKI PIOTR

(54) **Sposób jednostopniowego upłynniania natywnej skrobi**

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób jednostopniowego upłynniania natywnej skrobi z wykorzystaniem α -amylazy. Sposób ten charakteryzuje się tym, że jako enzym stosuje się α -amylazę pochodzącą od szczepu *Bacillus amyloliquefaciens* KU12, którą dodaje się w ilości od 0,012 do 0,1 U/mg natywnej skrobi do 1 - 40% roztworu natywnej skrobi i upłynnianie prowadzi się przy pH roztworu wynoszącym od 4,5 do 6,5, mieszając z szybkością ścinającą wynoszącą od 100 do 200 s⁻¹ i w przedziale temperatur od 70°C do 90°C, przy czym powyżej temperatury 82°C, stosuje się dodatek jonów wapnia Ca²⁺.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 428136 (22) 2017 04 17

(51) C22C 21/00 (2006.01)

(31) 2016121619 (32) 2016 05 31 (33) RU

(86) 2017 04 17 PCT/RU2017/000238

(87) 2017 12 07 WO17/209646

- (71) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOST'YU OBEDINENNAYA KOMPANIYA RUSAL INZHENERNO-TEKHNOLIGICHESKIY TSENTR, Krasnoyarsk, RU
 (72) KROKHIN ALEKSANDR YUR'EVICH, RU;
 ALABIN ALEKSANDR NIKOLAEVICH, RU;
 ZAJTSEV ANTON SERGEEVICH, RU;
 FROLOV VIKTOR FEDOROVICH, RU;
 TRIFONENKOV LEONID PETROVICH, RU;
 STRELOV ALEKSANDR VLADIMIROVICH, RU

(54) **Przewodnikowy stop aluminium i wyrób z niego**

(57) Niniejszy wynalazek dotyczy dziedziny metalurgii, w szczególności stopu na bazie aluminium, a także wyrobów z określonego stopu i może być stosowany przy wytwarzaniu produktów o przeznaczeniu elektrotechnicznym do produkcji kablowo-przewodowej dla instalacji elektrycznych budynków i budowli. Wynikiem technicznym jest wzrost plastyczności technologicznej drutu otrzymanego z proponowanego stopu dzięki utworzeniu ścisłych cząstek zawierających żelazo faz pochodzenia eutektycznego. Stop zawiera żelazo i krzem, a przy tym dodatkowo zawiera co najmniej jeden pierwiastek z grupy zawierającej nikiel i miedź przy następującym stosunku składników, w % wag.: żelazo 0,3 - 1,0; krzem 0,04 - 0,15; nikiel 0,005 - 0,2; miedź 0,1 - 0,3; aluminium - reszta, i charakteryzuje się strukturą, która stanowi matrycę tworzącą aluminiowy roztwór stały, w którym są równomiernie rozmieszczone cząstki zawierające żelazo w ilości nie mniejszej niż 1% obj., posiadające średnią wielkość nie większą niż 3 μ m, przy czym łączna ilość krzemu i miedzi w stopie nie przekracza 0,35% wag.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 425002 (22) 2018 03 23

(51) C23C 2/00 (2006.01)

B05C 1/08 (2006.01)

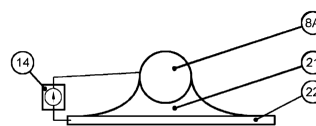
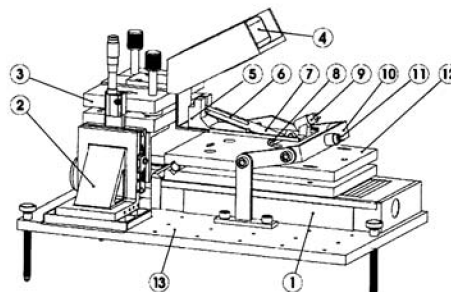
- (71) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków
 (72) BUDKOWSKI ANDRZEJ; RYSZ JAKUB; AWSIUK KAMIL;
 MARZEC MATEUSZ; DAŃCZYŃSKI PAWEŁ;
 MICHALIK MACIEJ

(54) **Urządzenie do oddziaływania na ciecz w menisku przesuwanym po podłożu i sposób prowadzenia reakcji**

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie zawierające platformę (12) na podłożu (22), element przewodzący (8), ruchomy względem platformy (12), do rozciągania cieczy na podłożu (22) w menisk (21). Urządzenie to charakteryzuje się tym, że zawiera

ponadto: układ aktywujący (11, 14) do zmiany parametrów fizykochemicznych i/lub wywoływania reakcji chemicznej w cieczy w menisku (21) i/lub na podłożu zwilżanym przez ciecz w menisku, sprzężony z elementem przewodzącym (8); przy czym element przewodzący jest bryłą asymetryczną obrotowo. Przedmiotem zgłoszenia jest ponadto, także sposób zmiany parametrów fizykochemicznych i/lub wywołania reakcji chemicznej w cieczy, w menisku lub na podłożu zwilżonym przez ciecz w menisku.

(33 zastrzeżenia)



A1 (21) 425043 (22) 2018 03 28

(51) C23C 2/00 (2006.01)

H01L 21/46 (2006.01)

H01L 21/02 (2006.01)

H01L 21/36 (2006.01)

H01L 21/368 (2006.01)

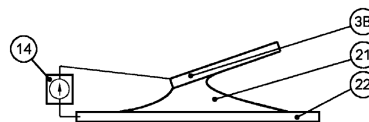
H01L 31/0216 (2014.01)

- (71) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków
 (72) BUDKOWSKI ANDRZEJ; RYSZ JAKUB; AWSIUK KAMIL;
 DAŃCZYŃSKI PAWEŁ; AUGUSTOWSKI DARIUSZ

(54) **Sposób wytwarzania warstw aktywnych polimerowych urządzeń optoelektronicznych**

(57) Sposób wytwarzania warstw aktywnych polimerowych urządzeń optoelektronicznych charakteryzuje się tym, że: przygotowuje się roztwór zawierający rozpuszczalnik i przynajmniej dwa polimerowe komponenty do utworzenia warstw aktywnych urządzenia optoelektronicznego; nakłada się roztwór na podłożu (22); wytwarza się menisk (21) poprzez dozowanie roztworu pomiędzy podłożo (22) a element przewodzący, na którego powierzchni znajduje się metalowa elektroda; przemieszcza się roztwór zapewniając przesuw elementu przewodzącego względem podłoża (22); za pomocą źródła napięcia (14) przyłączonego pomiędzy elektrodą na powierzchni elementu przewodzącego a podłożem (22) oddziałuje się na komponenty roztworu, wytwarzając warstwy aktywne urządzenia optoelektronicznego na podłożu (22).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 425045 (22) 2018 03 28

(51) C23C 2/00 (2006.01)

H01L 21/46 (2006.01)

H01L 21/02 (2006.01)

H01L 21/36 (2006.01)

H01L 21/368 (2006.01)

H01L 31/0216 (2014.01)

B05B 5/00 (2006.01)

B05B 5/12 (2006.01)